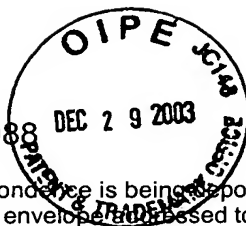


Docket No.: P2002,0988



I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service with sufficient postage as first class mail in an envelope addressed to: Commissioner for Patents, Alexandria, VA 22313 20231.

By: 

Date: December 23, 2003

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applic. No. : 10/722,025  
Applicant : Sven Mahnkopf et al.  
Filed : November 25, 2003  
Art Unit : to be assigned  
Examiner : to be assigned

Docket No. : P2002,0988  
Customer No.: 24131

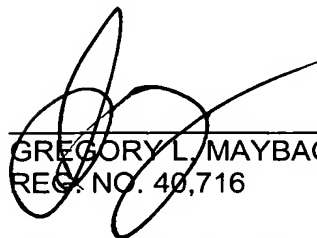
CLAIM FOR PRIORITY

Mail Stop: Missing Parts  
Hon. Commissioner for Patents,  
Alexandria, VA 22313-1450  
Sir:

Claim is hereby made for a right of priority under Title 35, U.S. Code, Section 119, based upon the German Patent Application 102 54 909.5 filed November 25, 2002.

A certified copy of the above-mentioned foreign patent application is being submitted herewith.

Respectfully submitted,

  
\_\_\_\_\_  
GREGORY L. MAYBACK  
REG. NO. 40,716

Date: December 23, 2003

Lerner and Greenberg, P.A.  
Post Office Box 2480  
Hollywood, FL 33022-2480  
Tel: (954) 925-1100  
Fax: (954) 925-1101

/mjb

# BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



## Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

**Aktenzeichen:** 102 54 909.5

**Anmeldetag:** 25. November 2002

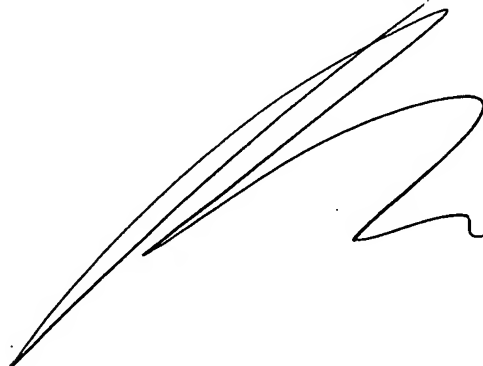
**Anmelder/Inhaber:** Infineon Technologies AG, München/DE

**Bezeichnung:** Abstimmbarer Halbleiterlaser und Herstellungsverfahren

**IPC:** H 01 S 5/187

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 6. November 2003  
Deutsches Patent- und Markenamt  
Der Präsident  
Im Auftrag



Kahle

## Beschreibung

## Abstimmbarer Halbleiterlaser und Herstellungsverfahren

- 5 Die vorliegende Erfindung betrifft einen abstimmbaren Halbleiterlaser, der in mindestens zwei Abschnitte der aktiven Schichtstruktur unterteilt ist.

10 In der US 4,896,325 ist ein abstimmbarer Halbleiterlaser mit einer Unterteilung der Resonatorstruktur in mehrere Abschnitte beschrieben. Die Spiegel an den Resonatorendflächen sind mit mehreren Elementen nach Art eines Fabry-Perot-Interferometers ausgebildet und lassen sich durch Anlegen geeigneter Spannungen auf unterschiedliche Reflexionsmaxima einstellen.

15 Ein weiterer Abschnitt des Resonators, der zur Erzielung eines hohen Lasergewinnes vorgesehen ist, und ein weiterer Abschnitt, der als Phasenschieber vorgesehen ist, werden ebenfalls über geeignete Spannungen angesteuert.

20 In der US 5,365,541 ist die Verwendung eines photonischen Kristalls als Resonatorendspiegel eines Lasers beschrieben. In der Spalte 5 dieser Schrift ist auch die Funktion der photonischen Kristalle näher erläutert. In Anlehnung an die Ausbildung von Valenz- und Leitungsband in Festkörpern mit gitterartiger periodischer Anordnung der Atome sind bei photonischen Kristallen periodisch variierende Bereiche wechselnden Brechungsindex vorhanden. Dadurch werden für die sich in dem photonischen Kristall ausbreitende Strahlung in Analogie zum Festkörper Bandlücken der Wellenlänge erzeugt, in denen

25 eine Wellenleitung nicht möglich ist. Derartige photonische Kristalle können daher für die betreffenden Wellenlängenbereiche als Spiegel eingesetzt werden.

30

In der US 5,684,817 ist ein Halbleiterlaser beschrieben, bei dem in dem Bauelement Bereiche photonischer Kristalle integriert sind, die jeweilige Resonatorendspiegel einer aktiven Laserstruktur bilden.

35

In der WO 94/16345 ist ein integriertes optoelektronisches Bauelement beschrieben, bei dem eine Wellenführung durch photonische Kristalle bewirkt wird. Die photonischen Kristalle sind in das Bauelement integriert, indem zylindrische Bereiche mit dielektrischem Material gefüllt sind.

In der US 6,141,370 ist ein binary superimposed Grating (BSG) beschrieben, bei dem Bereiche gleicher Länge und jeweils eines von zwei möglichen Werten des Brechungsindex vorhanden sind. Diese Bereiche wechseln in periodischer Folge ab, wobei allerdings eine ebenfalls periodische Phasenverschiebung überlagert wird. Es ist auf Anwendungen derartiger BSGs in abstimmbaren Halbleiterlasern hingewiesen.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, einen verbesserten und einfacher herstellbaren abstimmbaren Halbleiterlaser anzugeben.

Diese Aufgabe wird mit dem abstimmbaren Halbleiterlaser mit den Merkmalen des Anspruches 1 beziehungsweise mit dem Verfahren zur Herstellung eines solchen Halbleiterlasers mit den Merkmalen des Anspruches 8 gelöst. Ausgestaltungen ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen.

Der Halbleiterlaser verfügt über eine aktive Schicht in einer Resonatorstruktur mit einer Längsrichtung, die zur Wellenleitung und Modenselektion vorgesehen ist. Eine transversale Wellenführung wird bevorzugt durch Indexführung in einer Separate-Confinement-Hetero-Structure (SCH), eine laterale Wellenführung bevorzugt durch einen Rippenwellenleiter bewirkt, was an sich bekannt ist. Die Resonatorstruktur umfasst Resonatorendspiegel an den longitudinalen Enden und/oder mindestens ein Gitter, womit das Auftreten einer vorgesehenen Anzahl diskreter Moden erreicht wird.

Die Resonatorstruktur ist in mindestens zwei Abschnitte unterteilt, die mit Mitteln, insbesondere an dem Bauelement angebrachte Kontakte, für Strominjektion, vorzugsweise in jeden Abschnitt getrennt, versehen sind. Diese Abschnitte sind

5 durch unterschiedliche Abmessungen in der Längsrichtung oder durch die Ausbildung der daran angeordneten Gitterstrukturen so ausgebildet, dass die Abstände der darin jeweils auftretenden Moden in den Abschnitten voneinander verschieden sind.

10 Zumindest an den äußeren longitudinalen Enden der Resonatorstruktur, vorzugsweise an allen longitudinalen Enden der Abschnitte sind Begrenzungen aus photonischen Kristallen angeordnet. Der Wellenlängenbereich der Bandlücke der photonischen Kristalle umfasst einen Bereich maximalen Gewinns des

15 Lasers oder enthält eine hauptsächliche Wellenlänge des Lasers; die hauptsächliche Laserwellenlänge liegt vorzugsweise etwa in der Mitte der Bandlücke der photonischen Kristalle. Die Abweichung der Modenabstände in den Abschnitten kann durch die unterschiedliche Länge der Abschnitte zwischen den

20 jeweiligen Begrenzungen durch photonische Kristalle oder durch angebrachte Gitterstrukturen erzeugt werden. Als Gitter werden bevorzugt BSGs eingesetzt.

Es folgt eine genauere Beschreibung von Beispielen des ab-

25 stimbaren Halbleiterlasers anhand der Figuren 1 bis 5.

Die Figur 1 zeigt einen abstimmbaren Halbleiterlaser mit Gittern in einem Längsschnitt.

30 Die Figur 2 zeigt den Halbleiterlaser der Figur 1 in einem Querschnitt.

Die Figur 3 zeigt den Halbleiterlaser der Figur 1 in einem zu der Figur 2 parallelen Querschnitt.

35 Die Figur 4 zeigt eine schematisierte Draufsicht auf die Resonatorstruktur des Halbleiterlasers der Figur 1.

Die Figur 5 zeigt eine schematisierte Draufsicht auf die Resonatorstruktur eines weiteren Ausführungsbeispiels.

5 In der Figur 1 ist ein erstes Ausführungsbeispiel in einem Längsschnitt, das heißt, in einem Querschnitt des Bauelementes in der Längsrichtung der Resonatorstruktur, dargestellt. Die Schichtstruktur kann z. B. mittels Molekularstrahlepitaxie im Materialsystem von InGaAsP auf ein Substrat 1 aufgewachsen werden. Die Resonatorstruktur ist in mindestens zwei  
10 Abschnitte unterteilt, die z. B. je 400  $\mu\text{m}$  lang sind. Die Anzahl dieser Abschnitte ist nicht festgelegt. In dem in den Figuren 1 bis 4 dargestellten Ausführungsbeispiel sind drei Abschnitte 1a, 1b, 1c eingezeichnet.

15

Über und unter der für Strahlungserzeugung vorgesehenen aktiven Schicht 2 befinden sich Confinementschichten 3 für transversale Wellenführung. Es können auch getrennte Schichten für optisches und elektrisches Confinement vorgesehen sein. Die  
20 Schichten über und unter der aktiven Schicht 2 sind zum Zweck der Strominjektion für elektrische Leitung einander entgegengesetzter Leitfähigkeitstypen dotiert. Die Mantelschicht oder Deckschicht 4 aus Halbleitermaterial ist in einen oberseitigen Steg strukturiert, der in der Längsrichtung unterbrochen  
25 ist, so dass die den Abschnitten 1a, 1b, 1c zugeordneten Teilstege 5a, 5b, 5c gebildet sind.

Als Resonatorendspiegel und als Begrenzungen der Teilresonatorstrukturen entsprechend den Abschnitten 1a, 1b, 1c sind  
30 photonische Kristalle 6 vorgesehen. Es genügt, wenn die photonischen Kristalle 6 in der transversalen Richtung auf die Schichtlage der aktiven Schicht 2 begrenzt sind; die photonischen Kristalle 6 werden jedoch vorzugsweise erst nach dem Aufwachsen aller Halbleiterschichten hergestellt und umfassen  
35 dann wie eingezeichnet auch die Confinementschichten 3 und die Deckschicht 4.

Auf der Oberseite der Teilstege 5a, 5b, 5c befinden sich Kontakte 7a, 7b, 7c für eine getrennte Strominjektion in zumindest zwei der Abschnitte 1a, 1b, so dass der Laser betrieben und abgestimmt werden kann. Ein weiterer Kontakt 8 befindet sich auf der Unterseite des Substrates 1; dieser Kontakt 8 kann statt dessen auf der Oberseite des Bauelementes seitlich zu der streifenförmigen Resonatorstruktur angeordnet sein und mit der Unterseite der aktiven Schicht 2 über in dem Halbleitermaterial ausgebildete dotierte Bereich elektrisch leitend verbunden sein.

Die bei diesem Ausführungsbeispiel vorgesehenen Gitter 9a, 9b sind vorzugsweise lateral zu den Teilstegen 5a, 5b angeordnet und können als BSGs mittels Elektronenstrahl-Lithographie hergestellt werden. Die Gitter 9a, 9b sind vorzugsweise ebenso lang wie die zugehörigen Abschnitte 1a, 1b der Resonatorstruktur. Die Gitter 9a, 9b sind z. B. so ausgestaltet, dass sich in jedem Abschnitt 1a, 1b eine vorgesehene Anzahl, zum Beispiel zehn, Reflexionsmaxima ausbilden, wobei eine zentrale Mode im Bereich des Verstärkungsmaximums des Halbleitermaterials der aktiven Schicht (Gewinnmaximum) liegt und die Modenabstände im Verhältnis zu der Anzahl Moden so gewählt sind, dass Monomodigkeit erreicht ist. Ferner müssen sich die Abstände der Moden in den Abschnitten zumindest um etwa die Halbwertsbreite der Moden, das heißt der Reflexionspeaks, unterscheiden.

In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel mit jeweils etwa zehn Moden ist das der Fall bei Modenabständen im Bereich von 3 nm bis 10 nm, typisch etwa 5 nm, die sich in den beiden Abschnitten vorzugsweise um etwa 7 bis 10% unterscheiden. Die Abstimmung kann durch eine geeignete Variation der in die Abschnitte injizierten Ströme sowohl (quasi) kontinuierlich als auch mit einer Einbeziehung von Modensprüngen vorgenommen werden. Es können auch mehrere Abschnitte mit unterschiedlichen Modenabständen vorhanden sein.

Ein Reflektorendspiegel wird mit möglichst guter Reflexion, das heißt, mit einem Reflexionsfaktor nahe 1 ausgebildet, indem die photonischen Kristalle 6 dort hochreflektierend angeordnet werden. Der für Strahlungsausstritt vorgesehene andere Reflektorendspiegel kann zur Lichtauskopplung gespalten sein, was an sich bekannt ist. Die Oberseite des Bauelementes kann mit einer Planarisierungsschicht 10, z. B. aus BCB, eingeebnet sein. Die Konturen der Teilstege 5a, 5b, 5c sind daher in der Figur 1 als von der Planarisierungsschicht 10 verdeckte Konturen gestrichelt eingezeichnet. Das Abstimmen des Lasers erfolgt durch geeignete Variationen der in die Abschnitte injizierten Ströme.

Die Figur 2 zeigt den in der Figur 1 durch eine strichpunktierte Linie angegebenen Querschnitt durch einen Teilsteg 5a. Die Bezugszeichen entsprechen denen der Figur 1 und brauchen nicht gesondert erläutert zu werden. In der Figur 2 ist insbesondere erkennbar, dass die Gitter 9a seitlich des Steges angeordnet sind. In diesem Bereich des Lasers brauchen keine photonischen Kristalle vorhanden zu sein. Die Position des Querschnitts der Figur 1 ist in der Figur 2 durch die strichpunktierte Linie angegeben.

In der Figur 3 ist ein zu dem Querschnitt gemäß der Figur 2 koplanarer Querschnitt im Bereich zwischen zwei Teilstegen 5b, 5c dargestellt, dessen Position in der Figur 1 ebenfalls markiert ist. Die photonischen Kristalle 6 sind in diesem Beispiel auch in den zu dem Steg lateralen Bereichen zwischen den Teilstegen vorhanden. Zur Orientierung ist der in der Blickrichtung nächste Teilsteg 5c eingezeichnet, und zwar gestrichelt als von der Planarisierungsschicht 10 verdeckte Kontur.

In der Draufsicht der Figur 4 sind die Abschnitte 1a, 1b, 1c mit den Kontakten 7a, 7b, 7c erkennbar, die in diesem Beispiel die Oberseiten der Teilstege 5a, 5b, 5c jeweils vollständig bedecken. Die Struktur der Gitter 9a, 9b und der pho-



tonischen Kristalle 6 ist schematisiert eingezeichnet. Es ist erkennbar, dass die photonischen Kristalle üblicherweise ein hexagonales Raster bilden. Im Anschluss an die rechts eingezeichnete Bruchlinie können weitere integrierte elektronische oder optoelektronische Bauelemente folgen. Der dritte Teilsteg 5c kann zum Zweck einer besseren Lichtauskopplung zu einem Auskoppelbereich hin gebogen ausgestaltet sein. Der dritte Teilsteg 5c kann beispielsweise auch als Verstärker vorgesehen sein, der über die Kontakte 7c und 8 betrieben wird.

10

Es brauchen nicht alle Abschnitte mit einem jeweiligen Gitter versehen zu sein. Die Resonatorstruktur kann zwei oder mehr Abschnitte aufweisen, die jeweils durch die Länge und/oder angebrachte Gitterstrukturen voneinander verschieden sind.

15

Die in den Figuren 1 bis 4 dargestellte Struktur kann hergestellt werden, indem zunächst die Halbleiterschichten ganzflächig aufgewachsen und in der vorgesehenen Weise dotiert werden. Unter Verwendung einer Maske werden die Teilstege geätzt. Eine Maskenschicht, vorzugsweise eine  $\text{SiO}_2$ -Schicht, wird aufgebracht und mit einer Fotolackmaske entsprechend den herzustellenden photonischen Kristallen strukturiert. Der Fotolack wird entfernt. In den für die photonischen Kristalle vorgesehenen regelmäßigen Abständen werden unter Verwendung der strukturierten Maskenschicht Löcher in das Halbleitermaterial geätzt, vorzugsweise bis in die untere Confinementsschicht hinein. Das Material der Maskenschicht wird entfernt.

20

25

Unter Verwendung einer weiteren Fotolackmaske, die die für die Gitter vorgesehenen Bereiche frei lässt, wird eine Metallschicht abgeschieden und strukturiert, womit insbesondere ein jeweiliges BSG hergestellt wird. Nach dem Entfernen des Fotolacks wird ein dielektrisches Material, vorzugsweise BCB, aufgebracht, mit dem die für die photonischen Kristalle vorgesehenen Löcher gefüllt und die Oberseite planarisiert wird. Es werden schließlich die Kontakte aufgebracht.

30

35

Ein weiteres Ausführungsbeispiel verzichtet auf die Gitter, so dass die Resonatorstruktur allein durch die reflektierenden Begrenzungen der photonischen Kristalle 6 gebildet ist. In der Figur 5 ist eine schematisierte Draufsicht auf eine solche Resonatorstruktur dargestellt, in der die Abschnitte 1a, 1b, 1c ausgebildet sind. Diese Abschnitte 1a, 1b, 1c sind lateral und longitudinal von photonischen Kristallen 6 begrenzt, die außer der longitudinalen Reflexion auch die laterale Wellenführung bewirken.

Die Längen der Abschnitte 1a, 1b, 1c sind unterschiedlich gewählt, so dass sich die Modenabstände in den Abschnitten unterscheiden, vorzugsweise zumindest um etwa die Halbwertsbreite der Moden, das heißt der Reflexionspeaks. Aufgrund der Verstärkungseigenschaft des Halbleitermaterials der aktiven Schicht ist es möglich, eine vorgesehene Anzahl von Moden einzustellen. Um Monomodigkeit zu erreichen, werden die Modenabstände und die Modenanzahlen aufeinander abgestimmt. Auch bei diesem Ausführungsbeispiel können sich die Modenabstände in den Abschnitten um etwa 7 bis 10% unterscheiden und typisch im Bereich von 3 nm bis 10 nm liegen.

Bei diesem Ausführungsbeispiel erfolgt eine Grobabstimmung des Lasers durch eine geeignete Variation der in die Abschnitte injizierten Ströme; eine Feinabstimmung ist durch eine Veränderung der Temperatur möglich. Der Auskoppelbereich 11 befindet sich in diesem Beispiel an einem Ende der Resonatorstruktur, an dem die Begrenzung durch photonische Kristalle 6 ausreichend dünn ist, um einen Lichtaustritt zu ermöglichen. Auch bei diesem Ausführungsbeispiel können weitere integrierte elektronische oder optoelektronische Bauelemente vorhanden sein. Der letzte, zur Lichtauskopplung vorgesehene Abschnitt 1c der Resonatorstruktur kann hier ebenfalls gebogen zur Kante des Bauelementes geführt sein. Die Anzahl der Abschnitte ist nicht festgelegt; es genügen zur Abstimmbarkeit des Lasers zwei Abschnitte, in denen sich die Modenabstände in der vorgesehenen Weise unterscheiden.

Gegenüber bisherigen Ausgestaltungen abstimmbarer Halbleiter-  
laser bietet die erfindungsgemäße Lösung den Vorteil, dass  
die photonischen Kristalle einfach mittels Standard-Litho-  
5 graphieverfahren hergestellt werden können und so ohne großen  
Aufwand die Reflektivitäten und Kopplungsstärken der Ab-  
schnitte der Resonatorstruktur eingestellt werden können. Die  
durch die photonischen Kristalle realisierbaren hohen Index-  
sprünge ermöglichen die Herstellung neuartiger Resonatorgeo-  
10 metrien, die in der herkömmlichen Technik nicht möglich sind.

## Patentansprüche

1. Abstimmbarer Halbleiterlaser mit einer Resonatorstruktur, die

5 eine für Strahlungserzeugung vorgesehene aktive Schicht (2) sowie eine transversale und laterale Wellenführung aufweist, longitudinal in mindestens zwei Abschnitte (1a, 1b, 1c) unterteilt ist und

10 Resonatorendspiegel und/oder Gitter (9a, 9b) aufweist, mit denen das Auftreten einer vorgesehenen Anzahl diskreter Moden in den Abschnitten (1a, 1b, 1c) bewirkt wird, wobei für mindestens zwei der Abschnitte (1a, 1b, 1c) Mittel (7a, 7b, 8) zur getrennten Strominjektion in die aktive Schicht (2) vorgesehen sind,

15 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s die Moden voneinander Abstände aufweisen, die sich in mindestens zwei der Abschnitte (1a, 1b, 1c) der Resonatorstruktur unterscheiden, und  
20 zumindest an longitudinalen Enden der Resonatorstruktur photonische Kristalle (6) angeordnet sind, die als Bandlücke, in der keine Wellenleitung stattfindet, einen Wellenlängenbereich aufweisen, in dem eine hauptsächliche Wellenlänge des Lasers liegt oder ein maximaler Gewinn des Lasers auftritt.

25 2. Halbleiterlaser nach Anspruch 1, bei dem die Abstände der Moden sich in mindestens zwei der Abschnitte (1a, 1b) der Resonatorstruktur zumindest um etwa die Halbwertsbreite der Moden unterscheiden.

30 3. Halbleiterlaser nach Anspruch 1 oder 2, bei dem mehrere Abschnitte (1a, 1b, 1c) mit unterschiedlichen Modenabständen vorhanden sind.

35 4. Halbleiterlaser nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei dem die Abschnitte (1a, 1b, 1c) der Resonatorstruktur unterschiedliche longitudinale Abmessungen aufweisen.

5. Halbleiterlaser nach einem der Ansprüche 1 bis 4, bei dem zumindest ein Abschnitt (1a, 1b) der Resonatorstruktur mit einem Gitter (9a, 9b) versehen ist, das zur Modenselektion vorgesehen ist.

5

6. Halbleiterlaser nach Anspruch 5, bei dem das Gitter ein BSG ist.

7. Halbleiterlaser nach einem der Ansprüche 1 bis 6, bei dem die Modenabstände im Bereich von 3 nm bis 10 nm liegen.

8. Verfahren zur Herstellung eines Halbleiterlasers nach einem der Ansprüche 1 bis 7, bei dem

15 eine Halbleiterschichtstruktur, die mindestens eine für Strahlungserzeugung vorgesehene aktive Schicht (2) zwischen Confinementschichten (3) umfasst, aufgewachsen und in einer vorgesehenen Weise dotiert wird,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

20 unter Verwendung einer Maske Teilstege (5a, 5b, 5c) in die Halbleiterschichtstruktur geätzt werden,

eine Maskenschicht aufgebracht und mit einer Fotolackmaske entsprechend herzustellenden photonischen Kristallen strukturiert wird,

25 unter Verwendung der strukturierten Maskenschicht Löcher in das Halbleitermaterial geätzt werden,

die Maskenschicht entfernt wird,

unter Verwendung einer weiteren Maske, die Bereiche frei lässt, die für herzustellende Gitter vorgesehenen sind, eine

30 Metallschicht abgeschieden und zu mindestens einem Gitter strukturiert wird,

ein dielektrisches Material aufgebracht wird, mit dem die für die photonischen Kristalle vorgesehenen Löcher gefüllt werden, und

35 Kontakte aufgebracht werden.

## Zusammenfassung

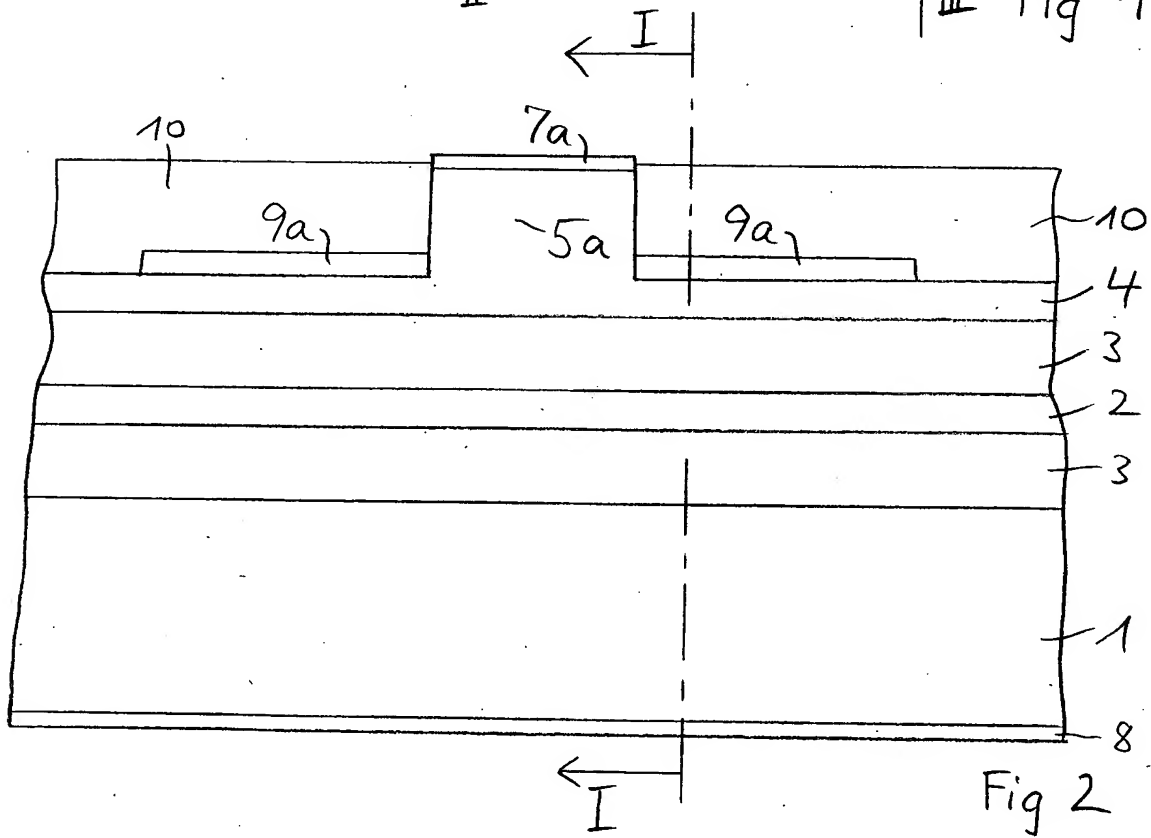
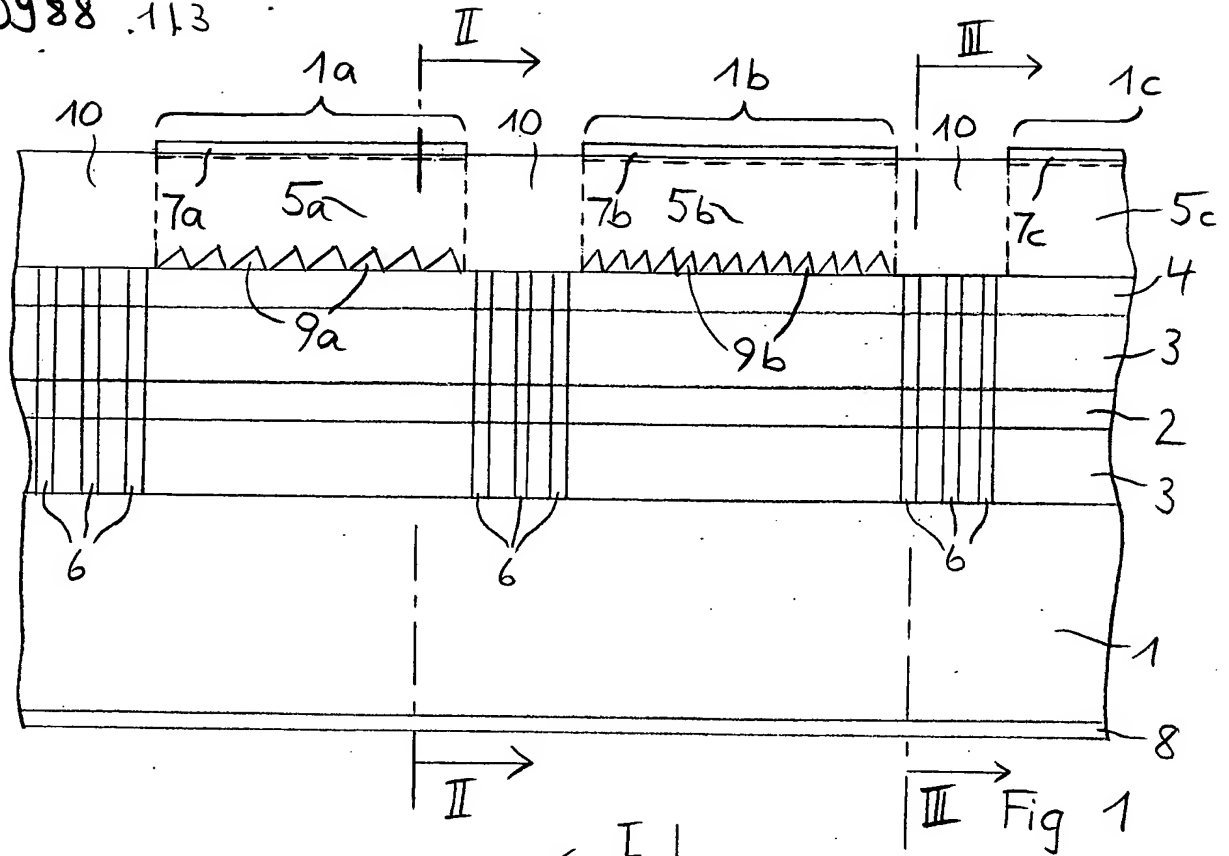
## Abstimmbarer Halbleiterlaser und Herstellungsverfahren

- 5 Die eine aktive Schicht (2) umfassende Resonatorstruktur ist in mindestens zwei Abschnitte (1a, 1b) unterteilt, in denen sich infolge unterschiedlicher Längenabmessungen oder durch dafür vorgesehene Gitterstrukturen (9a, 9b) die Modenabstände um 7 bis 10 Prozent voneinander unterscheiden. Als longitudi-
- 10 nale und gegebenenfalls als laterale Begrenzungen der Resonatorstruktur sind photonische Kristalle (6) integriert. Eine Variation der Ströme in den Abschnitten ermöglicht ein Durchstimmen des Lasers in einem weiten Wellenlängenbereich.

15 Figur 1

Bezugszeichenliste

- 1 Substrat
- 1a Abschnitt
- 5 1b Abschnitt
- 1c Abschnitt
- 2 aktive Schicht
- 3 Confinementschicht
- 4 Deckschicht
- 10 5a Teilsteg
- 5b Teilsteg
- 5c Teilsteg
- 6 photonischer Kristall
- 7a Kontakt
- 15 7b Kontakt
- 7c Kontakt
- 8 weiterer Kontakt
- 9a Gitter
- 9b Gitter
- 20 10 Planarisierungsschicht
- 11 Auskoppelbereich





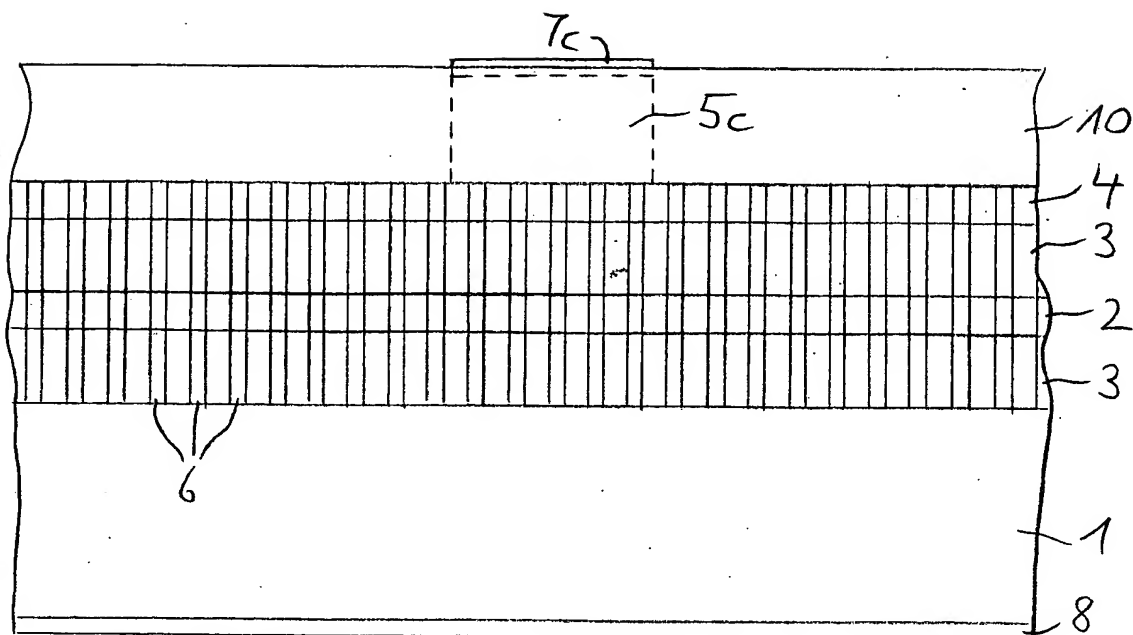


Fig 3

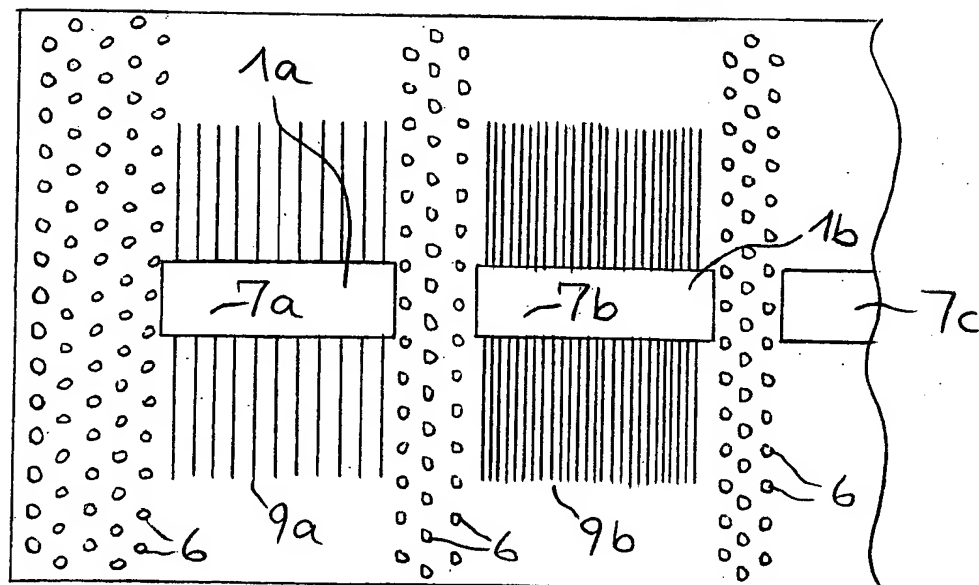


Fig 4

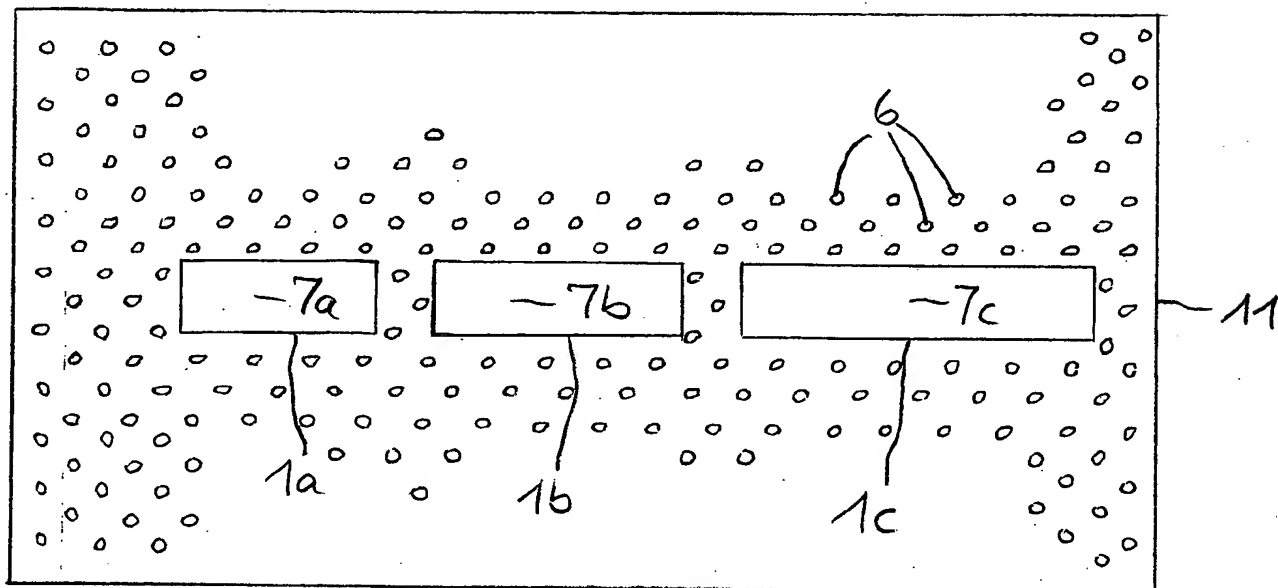


Fig 5